⑶　法人である場合には代表者の役職及び氏名、個人である場合はその者の氏名
⑷　許可・登録の状況（本社（店）の業種の追加は新規で申請）
⑸　営業所の所在地及び電話番号（営業所の新設廃止を含む）
添付資料
○　法人の住所、商号又は名称及び代表者の氏名に係る変更の場合は、登記事項証明書又は登記簿謄本（又は抄本）若しくはその写し
○　個人の住所の場合は、住民票の写し
○　個人の氏名の場合は、戸籍謄本（又は抄本）の写し
○　許可・登録の状況に係る変更の場合は、許可・登録の証明書等の写し
11　競争参加資格を有する者の名簿の閲覧先
http://www.maff.go.jp/j/supply/kensetu/meibo/index.html（農林水産省ホームページ内）
別記１　発注機関
大臣官房予算課、植物防疫所、那覇植物防疫事務所、動物検疫所、動物医薬品検査所、農林水産技術会議事務局筑波産学連携支援センター、農林水産研修所、農林水産政策研究所、北海道農政事務所、林野庁本庁（建築一式工事及び測量・建設コンサルタント等契約に限る。）及び水産庁
別記２　建設工事インターネット申請に係る納税証明書等の送付先
インターネット一元受付ヘルプデスク
ファクシミリ番号082―511―1102
別記３　申請書の提出場所
郵送・持参ともに
〒100―8950 東京都千代田区霞が関１－２－１　農林水産省大臣官房予算課営繕総括班（本館１階ドア№本120）電話03―3502―8111　内線3320
別記４　建設工事の場合の付与数値
総合評定値通知書の総合評点を総合数値とする。
別記５　測量・建設コンサルタント等の場合の付与数値
⑴　年間平均測量等実績高(A)

100億円以上		：60
50億円以上	100億円未満	：55
20億円以上	50億円未満	：50
10億円以上	20億円未満	：45
２億円以上	10億円未満	：40
１億円以上	２億円未満	：35
2,000万円以上	１億円未満	：30
1,000万円以上	2,000万円未満	：25
500万円以上	1,000万円未満	：20
300万円以上	500万円未満	：15
200万円以上	300万円未満	：10
200万円未満		：５

⑵　自己資本額(B)

10億円以上		：10
１億円以上	10億円未満	：８
1,000万円以上	１億円未満	：６
100万円以上	1,000万円未満	：４
100万円未満		：２

⑶　流動比率及び営業年数(C)
①　流動比率

130％以上		：14
95％以上	130％未満	：10
75％以上	95％未満	：６
60％以上	75％未満	：２

②　営業年数

25年以上		：10
10年以上	25年未満	：８
５年以上	10年未満	：６
５年未満		：４

⑷　総合数値は、上記(A)、(B)及び(C)の合計とする。
別記６　業種別等級区分及び予定価格の範囲
［掲載順序　業種の区分　①数値：等級　②予定価格の範囲］
⑴　土木一式工事
①

1,500点以上		：A
950点以上	1,500点未満	：B
750点以上	950点未満	：C
750点未満		：D

②　Aは２億円以上、Bは5,000万円以上２億円未満、Cは2,000万円以上5,000万円未満、Dは2,000万円未満
⑵　建築一式工事
①

1,200点以上		：A
1,000点以上	1,200点未満	：B
800点以上	1,000点未満	：C
800点未満		：D

②　Aは２億円以上、Bは１億円以上２億円未満、Cは3,000万円以上１億円未満、Dは3,000万円未満
⑶　その他の工事
①

1,000点以上		：A
850点以上	1,000点未満	：B
850点未満		：C

②　Aは7,000万円以上、Bは3,000万円以上7,000万円未満、Cは3,000万円未満
⑷　測量・建設コンサルタント等
①

80点以上		：A
60点以上	80点未満	：B
60点未満		：C

②　Aは1,000万円以上、Bは300万円以上1,000万円未満、Cは300万円未満

招　　請

資料提供招請に関する公表

次のとおり物品の導入を予定していますので、当該導入に関して資料等の提供を招請します。
平成 28 年 11 月１日
国立大学法人東北大学理事　佃　　良彦
◎調達機関番号　415　◎所在地番号　04
○第４号
１　調達内容
⑴　品目分類番号　24
⑵　導入計画物品及び数量
ナノ集積電子ビーム描画装置　一式
⑶　調達方法　購入等
⑷　導入予定時期　平成29年度５月以降
⑸　調達に必要とされる基本的な要求要件
1.ナノ集積電子ビーム描画装置は、以下の機能を備えていること。
１）電子ビームの加速電圧は100kV以上であること。
２）電子ビームは５nm以下のスポットビーム径に集束できること。
３）電子ビームの走査方式はベクタースキャン方式であること。
４）電子ビームの走査速度は100MHz以上であること。
５）300mmウェハの搬送から電子ビーム描画までの一連の動作が自動で行えること。
２　資料及びコメントの提供方法　上記１⑵の物品に関する一般的な参考資料及び同⑸の要求要件等に関するコメント並びに提供可能なライブラリーに関する資料等の提供を招請する。
⑴　資料等の提供期限　平成28年12月２日17時00分（郵送の場合は必着のこと。）
⑵　提供先　〒980―8577 仙台市青葉区片平２－１－１　東北大学財務部調達課調達第一係長　菊地　宏隆　電話022―217―4869
３　説明書の交付　本公表に基づき応募する供給者に対して導入説明書を交付する。
⑴　交付期間　平成28年11月１日から平成28年12月２日まで。
⑵　交付場所　上記２⑵に同じ。
４　説明会の開催　本公表に基づく導入説明会を開催する。
⑴　開催日時　平成28年11月８日10時00分
⑵　開催場所　東北大学国際集積エレクトロニクス研究開発センター３階第１会議室
５　その他　この導入計画の詳細は導入説明書による。なお、本公表内容は予定であり、変更することがあり得る。
６　Summary
⑴　Classification of the products to be procured : 24
⑵　Nature and quantity of the products to be purchased : Electron-beam Lithography System for Nanoscale Integration 1 Set
⑶　Type of the procurement : Purchase
⑷　Basic requirements of the procurement :
1.The electron-beam lithography system for nanoscale integration has to have following functions.
１）Acceleration voltage of electron-beam should be 100 kV or more.
２）Electron-beam should be focused to spot-beam diameter of less than 5 nm.
３）Scanning method of electron-beam should be vector scan method.
４）Scanning speed of electron-beam should be 100 MHz or more.
５）The electron-beam lithography system should have a function in which a series of operation from transfer of a 300 mm wafer to electron-beam lithography can be performed automatically.